

# Лазерный генератор изображений 4PICO PicoMaster 150

Лазерный генератор изображений 4PICO PicoMaster 150

**Производитель:**

4PICO

## Характеристики

### Описание

Лазерные генераторы изображений 4PICO представляют собой универсальные лазерные генераторы изображений с ультравысокой точностью, специально разработанные для предоставления пользователю максимальной свободы создания микроструктур в фоточувствительных слоях. Принцип растривания генератора обеспечивает равномерное экспонирование по всей поверхности. Сканирование подложки с высокой скоростью и шаговый привод экспонирующего модуля с программной регулировкой высоты делает MicroMaster 150 идеальным фотолитографическим инструментом для исследований, разработок, а также для опытного и мелкосерийного производства.

### Ключевые особенности лазерных генераторов 4PICO серии PicoMaster:

- 4 режима экспонирования - 0,3 мкм, 0,6 мкм, 0,9 мкм, 5 мкм;
- Переключение режимов экспонирования в ПО установки, без смены объективов;
- Экспонирование одной топологии разными режимами в одном рецепте для увеличения производительности;
- Уникальная запатентованная конструкция экспонирующего модуля, позволяющая автофокусу моментально обрабатывать все неровности подложки;
- Экспонирование многослойных структур с совмещением по меткам;
- Полутоновое экспонирование;
- Возможность замены экспонирующего модуля на новый путем откручивания 4 винтов, без дополнительных настроек и калибровок (минимальное время

простая);

- Понятное и функционально насыщенное ПО, позволяющее при необходимости настроить процесс на самых глубоких уровнях.

## Зависимость скорости экспонирования от минимального размера пятна

Разрешение	Скорость экспонирования при 50% наложении (normal quality)	Скорость экспонирования при 30% наложении (reduced quality)
0,3 мкм	1,4 мм <sup>2</sup> /мин	2,1 мм <sup>2</sup> /мин
0,6 мкм	2,8 мм <sup>2</sup> /мин	4,2 мм <sup>2</sup> /мин
0,9 мкм	4,2 мм <sup>2</sup> /мин	6,4 мм <sup>2</sup> /мин
5 мкм (опция)	23 мм <sup>2</sup> /мин	35 мм <sup>2</sup> /мин

### Доступные опции:

- Замена источника излучения 405нм на источник с длиной волны 375нм;
- Модуль поддержания температуры и влажности в рабочем объеме генератора;
- Запасной экспонирующий модуль (375нм или 405нм на выбор).

<b>Максимальный размер подложки</b>	160x160 мм
<b>Область экспонирования</b>	150x150 мм
<b>Разрешение</b>	0,3 мкм, 0,6 мкм, 0,9 мкм, 5 мкм (выбирается в ПО)
<b>Источник излучения</b>	Диодный УФ лазер
<b>Длина волны источника излучения</b>	405 нм (опционально 375 нм)
<b>Автофокус</b>	Лазерный
<b>Совмещение по меткам</b>	Камера высокого разрешения
<b>Защита от вибраций</b>	Гранитное основание
<b>Тип корпуса</b>	Настольный
<b>Вакуум</b>	Внешний насос